

# De l'atome à la puce

## Devoir surveillé de rattrapage

Durée : 2 heures Calculatrices autorisées (tous types)

Les exercices sont indépendants Vous devez expliquer le détail de votre raisonnement. Un résultat seul ne suffit pas.

#### Les données utiles :

Soit h la constante de Planck : h = 6,626.  $10^{-34}$  J.s Soit  $\epsilon_0$  la permittivité du vide.  $\epsilon_0$  = 8,854. $10^{-12}$  F.m Soit G la constante gravitationnelle : G = 6,674 . $10^{-11}$  m³.kg<sup>-1</sup>.s<sup>-2</sup> (ou N.m².kg<sup>-2</sup>) On a aussi  $1/(4\pi\epsilon_0)$  = 8,9. $10^9$  N.m².C<sup>-2</sup> c = 3. $10^8$  m.s<sup>-1</sup> (vitesse de la lumière) Le "gap" du silicium est E<sub>g</sub> = 1,12 eV à 25°C On prendra la charge élémentaire e = 1,6. $10^{-19}$  C k = 1,38. $10^{-23}$  J.K<sup>-1</sup> Dans le silicium,  $\mu_p$  = 0,04 m².V<sup>-1</sup>.s<sup>-1</sup> et  $\mu_e$  = 0,14 m².V<sup>-1</sup>.s<sup>-1</sup>

#### A. Le modèle de Bohr.

Soit un électron de masse me, un noyau de masse mn,

Retrouvez, selon l'hypothèse de Bohr, la relation liant l'énergie totale de l'électron de l'atome d'hydrogène au "nombre quantique principal" n.

- a. Faites le bilan des forces s'appliquant sur l'électron tournant à une distance re vitesse ve autour du noyau.
  - d. A l'équilibre, exprimez r<sub>e</sub> en fonction de e, m<sub>e</sub> et v<sub>e</sub>.
- c. Exprimez l'énergie cinétique  $E_c$  de l'électron en fonction de e et  $r_c$  l'énergie potentielle  $E_p$  de l'électron dans le champ électrique exercé par le fonction de e et  $r_c$ .
- d. Ecrivez la relation de De Broglie associant quantité de mouvement d'onde.

e. En appliquant l'hypothèse de Bohr, exprimez le rayon  $r_n$  de l'orbite n de l'électron en fonction de n et  $m_e$  (et des autres constantes fondamentales).

### Application numérique :

Lors de la relaxation, il y a émission d'une radiation, d'énergie hv (relaxation radiative).

Soit v la fréquence de la radiation

Calculer la longueur d'onde correspondant au passage de l'électron :

- a- de l'état n=2 à l'état fondamental
- b- du troisième état excité au 1er état excité

### B. Dopage et conductivité du silicium.

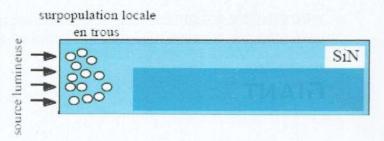
Le silicium est, non dopé, un semi-conducteur intrinsèque. On négligera la présence d'éventuelles impuretés avant dopage. Sa conductivité intrinsèque est  $\sigma_i = 2,5.10^{-4} \text{ S.m}^{-1}$ .

- a. Ce silicium est dopé par des atomes d'azote.
- b. Calculer la concentration (n ou p selon le cas) d'atomes de dopant à introduire dans le Si pour qu'il possède une conductivité de 530 S.m<sup>-1</sup>.
- c. Vérifier l'approximation faite en b.
- d. Calculer le % d'atomes de dopant par rapport au nombre d'atomes de Si, sachant qu'il y a 4,99.10<sup>22</sup> atomes de Si par cm<sup>3</sup>.
- e. Faire le schéma énergétique des bandes de valence, interdite et de conduction, en faisant apparaître E<sub>V</sub>, E<sub>C</sub>, E<sub>Fi</sub>, E<sub>g</sub>. On considèrera, pour le Si intrinsèque, qu'il y a autant de porteurs de charges e (électrons) que h<sup>+</sup> (trous) et donc que le niveau de Fermi est situé au milieu de la bande interdite.
- f. Rappeler les expressions des concentrations en électrons (n) et en trous (p) dans chacune des bandes.
- g. Calculer la variation de l'énergie de Fermi pour le silicium de la question b., par rapport au silicium intrinsèque, pour une température de 25°C.
- h. Sur un nouveau schéma, positionner le niveau de Fermi E<sub>Fn</sub> (respecter l'échelle).

#### C. Diffusion des charges dans un semiconducteurs

a. Rappeler la loi régissant la diffusion (Fick générale, puis appliquée aux charges)

On considère une zone d'un semi-conducteur de type n éclairée (en x = 0), tandis que le reste du même semi-conducteur est dans le noir complet. L'énergie qu'amène l'éclairage permet la génération de paires électrons-trous.



On prend  $n=1.10^{18}~cm^{-3}$  et  $ni=1,4.10^{10}~cm^{-3}$ . L'éclairage amène localement (en x=0)  $10^6~cm^{-3}$  trous.

- b. A quoi est égal p dans le noir ? (pour x=∞)?
- c. A quoi est égal p(x=0) sous l'éclairage ?
- d. Rappeler la relation liant p(x) à p(x=0), x et  $L_p$ , longueur de diffusion des trous dans le silicium.
- e. Posez l'application numérique permettant de calculer la longueur de diffusion des trous dans ce matériau, sachant que la concentration de trous est égale à  $p(x=5 \mu m) = p(x=\infty) + 100 \text{ cm}^{-3}$ .

#### D. Procédés de lithographie

- a. Rappelez le procédé général de gravure par lithographie (photorésist, illumination, lift-off, évaporation, épitaxie, etc.)
- Décrivez, étape par étape (avec des schémas clairs), la gravure d'un transistor bipolaire npn. Précisez les matériaux utilisés.
- c. Décrivez, étape par étape (avec des schémas clairs), la gravure d'un transistor unipolaire nMOS. Précisez les matériaux utilisés.

#### E. Transistor unipolaire

Expliciter le fonctionnement d'un transistor nMOS à enrichissement. Utilisez tous les schémas que vous jugerez utile d'utiliser.